



2019年4月16日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 山村 章
 (J A S D A Q : コード 6 8 9 0)
 問 合 せ 先 取締役経営企画担当 若木 啓男
 (0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

韓国子会社における CVD-SiC 事業からの撤退に関するお知らせ

弊社は、この度、韓国連結子会社 Ferrotec Advance Materials Korea Corporation (以下、「FTAK」といいます。) における CVD-SiC 事業 (以下、「本事業」といいます。) から撤退することを本日決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 撤退に至る経緯

本事業につきましては、昨今の半導体チップの細線化や多層化プロセスの増加に伴い、半導体装置メーカーからの増産要請が相次いでおりましたが、特定の製品に関して、競合他社との低価格競争により、投資採算を確保するのが難しくなった為、2016年に外資投資誘致優遇策が充実している韓国忠清南道唐津市 (以下、「行政当局」といいます。) において FTAK を設立し、コスト低減と量産化に対応できる新型の CVD 炉の開発を進めながら、量産の準備を進めて参りました。しかしながら、2019年2月14日付弊社リリースにてお伝えしました通り、当該 CVD 炉に関して、FTAK 及び同社元従業員3名が、不正競争防止及び営業機密保護に関する法律違反の容疑により韓国検察当局から起訴されたことに伴い、FTAK での本事業の継続可能性について弊社内においてこれまで慎重に検討を重ねて来た結果、本事業の将来に渡る安定的な収益の確保が困難と判断し、この度本事業から撤退することとなりました。尚、弊社としては、公判の場において無罪の主張をしていく所存ではありますが、昨今の韓国における日系企業に対する司法判断等を鑑みた場合、同国における司法判断の独立性が完全に担保されない懸念があることから、ステークホルダーの皆様へ与える影響を考慮し、潜在的なリスクを現段階で最小化することが最も適切であると判断し、この度の決議に至ったものであります。

2. 連結子会社並びに廃止する事業の概要

(1) 名 称	Ferrotec Advanced Materials Korea Corporation		
(2) 所 在 地	忠清南道唐津市松山面佳谷路 120		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 山村 丈		
(4) 事 業 内 容	CVD-SiC 製品®の開発、製造、販売		
(5) 資 本 金	160 億 KRW		
(6) 設 立 年 月 日	2016 年 6 月 9 日		
(7) 大株主及び持株比率 (平成 31 年 4 月 16 日 現 在)	株式会社フェローテックホールディングス		100%
(8) 当該会社の CVD-SiC 事業の経営成績			
決算期	2016 年 12 月期	2017 年 12 月期	2018 年 12 月期
売 上 高	0 千 KRW	0 千 KRW	0 千 KRW

	(0 千円) 連結売上高構成比: 0%	(0 千円) 連結売上高構成比:0%	(0 千円) 当期の連結決算は 4 月 16 日現在未公表
売上総利益	0 千 KRW (0 千円) 連結総利益構成比: 0%	-1,270,575 千 KRW (-127,058 千円) 連結総利益構成比: -0.5%	10,560 千 KRW (1,060 千円) 同上
営業利益	-457,394 千 KRW (-43,132 千円) 連結営業利益構成比: 7.6%	-2,620,652 千 KRW (-262,065 千円) 連結営業利益構成比: -3.1%	-3,764,015 千 KRW (-377,907 千円) 同上
経常利益	-456,165 千 KRW (-43,016 千円) 連結経常利益構成比: -0.8%	-4,195,573 千 KRW (-419,557 千円) 連結経常利益構成比: -5.9%	-3,796,645 千 KRW (-381,183 千円) 同上

※KRW = 韓国ウォン

※CVD-SiC 事業に属する従業員及び資産等の取扱い

建屋および共有設備、また従業員の一部に関して、他の事業に転用すべく、事業計画を検討中です。

3. 日程

(1) 取締役会決議日	平成 31 年 4 月 16 日
(2) 事業撤退期日	未定（行政当局との調整が付き次第速やかに撤退予定）

4. 今後の見通し

- (1) 当該事業からの撤退による業績への影響につきましては、現段階での損失見込み額としては、CVD-SiC 炉の廃棄費用等で 4 億円~6 億円と見込んでおりますが、これ以外に今後、代替事業の計画の精査、および行政当局との交渉次第では追加で発生する可能性があります。損失額が確定しだい速やかにお知らせいたします。
- (2) なお、本事業からの撤退に伴い、現在、FTAK において他の事業を行うことを検討しております。代替事業が決定し、かつ行政当局の承認が得られ次第、速やかにお知らせいたします。
- (3) 今回の事業撤退は FTAK における同事業に限定したものであり、弊社 100%子会社のアドマップ（岡山県玉野市）では、引き続き日本国内で同製品の生産を行い、旺盛な需要に対応し中長期的な事業拡大に取り組んで参ります。

以上

④ CVD-SiC とは、CVD 法（シリコン成分と炭素成分を含むガスを反応させて製作する手法）で製作した SiC(Silicon Carbide : 炭化ケイ素)の事を言います。その特性として、高純度・高耐食性・高耐酸化性・高耐摩耗性である事から、CVD-SiC 製品は、主に半導体製造プロセスにおけるパターニングで各種ガスを用い、高温で加工処理が必要なエッチング真空装置、成膜真空装置などの治具・消耗材として使用されます。